

SiHF

SiHF

Русин А.Д., Конієві.р. 1974.
"гр.

м.н.

Отчет Химического
к-та МГУ за 1973-74г
по договору № 74/154
между хим. к-том МГУ
и ГИИХ-ом.

стр 19

исследование  периодич. об. б
изучают. продукт высоко-
модиф.

HSiF

Одесск 14813

1982

ЗБ216. Исследования методом матричной изоляции реакций атомов кремния. II. Инфракрасный спектр и структура матрично-изолированного фторсилилена: HSiF. Matrix isolation studies of the reactions of silicon atoms. II. Infrared spectrum and structure of matrix-isolated fluorosilylene: HSiF. Ismail Zakya Kafafi, Fredin Leif, Hauge Robert H., Marggraff John L. «J. Chem. Phys.», 1982, 77, № 4, 1626—1631 (англ.)

Di, сел. рад.

Х
HF

Измерены ИК-спектры продуктов р-ции атомов кремния с молекулами HF в матрице из Ag при 15 К. Даны схема эксперим. установки. Методика и условия эксперимента не отличались от используемых ранее (см. пред. реф.). Отнесение полос проводили на основании исследования продуктов реакции Si+DF в Ag и аннелирования и фотолиза матриц. В ИК-спектрах матриц непосредственно после формирования кроме полос примесей SiH₂, SiH₄, Si₂C и SiF₄ наблюдены новые полосы 1913,1; 859,0 и 833,7 см^{-1} , отнесенные к колебаниям $\nu_1(\text{H-Si})$, $\nu_2(\text{HSiF})$ и $\nu_3(\text{Si-F})$ соотв. радикала HSiF. При высоких конц-иях атомов Si в матрице в-спектрах обна-

ж. 1983, 19,
N 3

ружены полосы в области 3658 см^{-1} , предположительно связанные с образованием соединений типа $\text{Si}_x(\text{HF})_y$. Показано, что фотолиз матриц как во время, так и после осаждения приводит к повышению выхода HSiF . Новые полосы, появляющиеся после фотолиза уже сформированных матриц ($873,8$ и $914,8 \text{ см}^{-1}$), не идентифицированы. Отмечено, что р-ция $\text{Si} + \text{DF}$ протекает медленнее, вероятно, вследствие кинетич. изотопного эффекта. Проведен расчет частот и форм нормальных координат и рассчитано силовое поле HSiF , к-рое хорошо воспроизводит эксперим. частоты. Отмечено подобие силовых полей HSiF и HSiOH . Для валентного угла в HSiF принято значение $100 \pm 3^\circ$. В гармонич. приближении рассчитаны термодинамич. функции идеального газа HSiF в интервале т-р $298,15$ — 5000 К .

С. Б. Осин

ис
л. и

HSiF

14813

1982

97: 229124u Matrix isolation studies of the reactions of silicon atoms. II. Infrared spectrum and structure of matrix-isolated fluorosilylene: HSiF. Ismail, Zakya Kafasi; Fredin, Leif; Hauge, Robert H.; Margrave, John L. (Rice Quantum Inst., Rice Univ., Houston, TX 77251 USA). *J. Chem. Phys.*, 1982, 77(4), 1626-31 (Eng). Si spontaneously reacts with HF and DF to form the mols. HSiF and DSiF in solid Ar. Photolysis of the matrix during deposition greatly enhances the yield of these products. Frequencies for the 3 IR active modes of HSiF and DSiF were accurately measured. The force field of this triat. mol. was fully detd. through normal coordinate analyses. Thérmodn. functions for the fluorosilylene were calcd.

LL chukmp
6
Mampulse,
CMyukrypa

C.A. 1982, 97, N26.

SiHF

N14813 ИК в мазиц
пенеи зеки. не Рад

Ismail Z.K., Fredin L.

Hauge R.H., Margrave J.L.

J.Chem.Phys. 1982, 77 (4); 1626-1631.

ИК спектр и оптические характеристики SiHF
изотоп. в мазиц.

Si реагирует с HF и D₂F в мазиц.

HSiF

D₂S₂F

$\nu_1 = 1913, \text{cm}^{-1}$ 1383 (SiH, SiD)

$\nu_2 = 859, \text{cm}^{-1}$ 638 ~~X HSiF~~

$\nu_3 = 833, \text{cm}^{-1}$ 838, 9 (SiF)

Спектральная область. 2(Si-H) и
2(Si-F) приведены в мазиц. и 1000
SiH₂ и SiF₂. Округл. 6 ТГц.
~~100 ± 30~~ Определено

~~надежно~~

$$K_{Si-H} = 2,112 \text{ } \frac{\text{нгум} \cdot \text{А}^{-1}}{\text{нм}}, \quad K_{HS; F} = 0,916 \text{ нгум} \cdot \text{А} (100)$$

$$K_{HS; F, Si-F} = 0,243 \text{ нгум}$$

$$K_{HS; Si-F} = K_{HS; F, Si-H} = 0.$$

Мад. темп. Расср. 20% \rightarrow 96,6°

1913,1	200	1920,9	1920,9
859,0	850	859,2	860,2
833,7	900	833,2	833,3.

1382	1383,0	1382,8
637,4	637,2	637,0.
833,4	832,2	833,2

Приведены в г.-ми. (средне
значение).

лр.	ст.	т°.
248,15	33,492 33,1581.	232,533 232,952
10000	53,162 52,5552	503,452 288,148
2000	63,393	334,643
3000	57,9128	247,470
5000	62,069 54,9107	333,131 378,761

Ismail 49,1
1432-

Линия с пиком
и-зональной (~10%)
и края зоны (5000 см^{-1})

Δφ 5,8 - 9,54 ДМ.Крас

Δφ 0,4 - 8 ДМ.Крас

ΔS 5 - 14,4 " - "

SILF

[Om. 17361]

1983

empyknyp.
koreebam.
racemombr

Colvin M.E., Grev R. S.,
et al.,

Chem. Phys. Lett.,
1983, 99, N5-6, 399 -
-405.

SiHF^{M.C.}
(SiH₂)
SiF₂)
Colvin,^{M.C.} Geev R.S., Schaefer H.F. 1983
Chem. Phys. Lett. 1983, 99, 156, 393-405.

$\tilde{\chi}^1_{A_1}$, $\tilde{\alpha}^3B_1$ and $\tilde{\delta}^1B_1$ electronic states of silylenes.
Structures and vibrational frequencies
of SiH₂, SiHF and SiF₂.

New, pacrif SCF CI DZ + P-Sagen
spectra and redshifts u v; b. 3^x Heundelius
co, johnd

	$\tilde{\chi}^1 \text{ A}_g$	$\tilde{\alpha}^3 \text{ A}''$	$\tilde{\alpha}^2 \text{ A}''$	
$\nu_1(\text{Si-H})$	1.510	1.463	1.482	$\nu_{20,005} \text{ SiH}_2$
$\nu_2(\text{Si-F})$	1.596	1.592	1.594	- $\nu_{10,013} \text{ SiF}_2$
$\theta_c(\text{HSiF})$ A^0	97,6°	115,2°	115,3°'	measured $\text{SiF}_2(93,9)$ $\text{SiH}_2(93,9)$
$\nu_1(\text{Si-H})$	2059(1913)	2342	2148	
$\nu_2(\text{HSiH})$	961(859,862)	864	804(~ 560)	
$\nu_3(\text{Si-F})$	896(834)	924	915	
ω		↓ measured		

HSiF

[Om. 17362]

1983

99: 166310v Laser-induced fluorescence of the fluorosilylene (HSiF) radical. Lee, Henry U.; Deneuville, John P. (Mater. Dev. Lab., Energy Conversion Devices, Inc., North Branch, NJ 08876 USA). *Chem. Phys. Lett.* 1983, 99(5-6), 394-8 (Eng). HSiF was detected by laser-induced fluorescence, following the formation of the ground-state radical in the flow reaction of SiH₄ with F₂ at a total pressure of 0.05-0.15 torr. The radiative lifetime is given for the 1st vibronic state of HSiF (A^1A'') as well as a tentative assignment of the prominent bands of the $\bar{A}^1A'' - \bar{X}^1A'$ transition.

layer. boy.
process.

C.A. 1983, 99, N 20

SiHF

1984

Schlegel H. B.

реактивы,
эмпуктыва,
 P_i , ΔH_f , ΔS .

Z. Phys. Chem., 1984,
88, № 5, 6254–6258.

(C_{res.} SiH₂; III)

SiHF

Lm. 20355 / 1984

Sosa C., Schlegel H.B.

ab initio J. Amer. Chem. Soc.,
pacrim. 1984, 106, N 20,

5847 - 5852.

HSiF

(On. 21575) 1985

20 Б1201. Анализ вращательной структуры спектра возбуждения флуоресценции перехода $\tilde{A}^1A'' - \tilde{X}^1A'$ радикала HSiF вблизи 430 нм с допплеровским разрешением. The rotational analysis of a doppler-limited $\tilde{A}^1A'' - \tilde{X}^1A'$ fluorescence excitation spectrum of HSiF at 430 nm. Dixon R. N., Wright N. G. «Chem. Phys. Lett.», 1985, 117, № 3, 280—285 (англ.)

С использованием лазера на красителе с мощностью 25 мВт с накачкой от аргонового лазера исследован спектр возбуждения флуоресценции радикала HSiF, полученного в MB — разряде в смеси SiH₄ с CF₄. Идентифицирована вращат. структура 0—0-полосы системы электронного перехода $\tilde{A}^1A'' - \tilde{X}^1A'$. Помимо линий разрешенных переходов (всего 514) идентифицировано 150 линий запрещенных переходов, для к-рых изменения обоих квантовых чисел, K_a и K_c , четные. Распределение интенсивности запрещенных переходов удовлетворительно описывается по ф-ле Хоугена—Уотсона, учитывая-

и.п.

X. 1985, 19, № 20

щей поворот осей инерции молекулы при электронном возбуждении. Определены значения, вращат. и квартичных центробежных постоянных для основного и возбужденного электронных состояний: валентный угол при возбуждении изменяется от 98 до 115° . Е. В. Алиева

сель
тем

HSiF

DM 21575

1985

11 Л437. Анализ вращательной структуры спектра возбуждения флуоресценции $\tilde{A}^1A'' - \tilde{X}^1A'$ HSiF вблизи 430 нм, ограниченного по разрешению доплеровским уширением. The rotational analysis of a doppler-limited $\tilde{A}^1A'' - \tilde{X}^1A'$ fluorescence excitation spectrum of HSiF at 430 nm. Dixon R. N., Wright N. G. «Chem. Phys. Lett.», 1985, 117, № 3, 280—285 (англ.)

С помощью перестраиваемого лазера получен с высоким разрешением спектр возбуждения флуоресценции $\tilde{A}^1A'' - \tilde{X}^1A'$ радиакала HSiF. Радикалы HSiF получали МВ разрядом смеси $CF_4/SiH_4/N_2$. Показано, что в спектре наряду с вращательными полосами типа с наблюдаются запрещенные подполосы с необычными значениями ΔK , возникающие вследствие различия геометрии HSiF в основном и возбужденном состояниях (т. наз. случай поворота осей). Из анализа вращательной структуры вычислены спектроскопич. постоянные и геометрич. параметры HSiF в состояниях \tilde{A}^1A'' и \tilde{X}^1A' . Е. Н. Т.

ll. N., геометрич.
структур

cf. 1985, 18, N 11

HSiF

Om. 21575.

1985

103: 45269f The rotational analysis of a Doppler-limited $\tilde{A}^1A''-\tilde{X}^1A'$ fluorescence excitation spectrum of fluorosilylene (HSiF) at 430 nm. Dixon, R. N.; Wright, N. G. (Sch. Chem., Univ. Bristol, Bristol, UK BS8 1TS). *Chem. Phys. Lett.* 1985, 117(3), 280-5 (Eng). A rotational anal. is presented for the type-c origin band of an $\tilde{A}^1A''-\tilde{X}^1A'$ electronic transition of HSiF, recorded at Doppler-limited resoln. using laser-induced fluorescence. An extension of the equations of J. T. Hougen and J. K. G. Watson (1965) quant. accounts for the intensity of many axis-tilting branches, and the corresponding depletion of the regular type-c branches, with a tilting angle of 2.3°. The bond angle increases from about 98 to 115° on excitation.

($\tilde{A}^1A''-\tilde{X}^1A'$)

fransam.
arany

C.A. 1985, 103, N6

SiHF

Dixon R.N., Wright N.G. 1985

Chem. Phys. Lett., 1985, 117, w3, 280-285

The rotational analysis of a Doppler-limited $\tilde{A}^1A'' - \tilde{X}^1A'$ fluorescence excitation spectrum of SiHF at 430nm.

Microgralabs

Harold Kroto

($\sim 155 \text{ cm}^{-1}$) $\text{v}_{23225-23380 \text{ cm}^{-1}}$

yesterdays draft

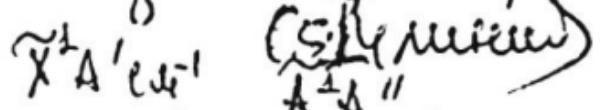
$\tilde{A}^1A''(\text{odd}) - \tilde{X}^1A'(\text{odd})$



blanks

spare (each blank)

HSiF конкурирует с SiF реализуя синтез со спиралью атомарных группировок
 ионов при изображении с CF₄. (С HSiF синтез минимум).
 Кисл. обра ко Fe. Ar⁺ + dye дают SiW (Фото 2 на)?
 Чис. 8) возможное K⁺ ≤ 5, K'' ≤ 4. P, Q & L есть. (Фото. № 4. 100.1000 + 9005)



A_0 7,5828(10) 5,2197(8).
 B_0 0,56429(8) 0,54897(8)

C_0 0,52371(8) 0,51617(8).

ω_{SiK} 0,855(88) 0,880(10)

ω_{SiK} 22(2) 37,0(14)
 ω_{SiS} 0,92(10) 0,86(10)

ω_{SiP} (Фото 2)

χ_{10} 23,26,0,0,25(2).

	Coef.	$\omega(\text{Si-H})$	$\omega(\text{Si-X})$	χ
HSiF $\tilde{\chi}^1 A'$	1,510	1,596	97,6	[9] 1983
	1,534	1,604	(97,6)- фото	

$\tilde{\chi}^1 A''$ 1,482 1,594 115,3 [9]

$\tilde{\chi}^1 A''$ 1,543 1,593 (115,3) фото

HSiCl $\chi^3 A'$ 1,561 2,064 102,8 (4)

$\tilde{\chi}^1 A''$ 1,483 2,047 116,1 (4)

HSiBr $\tilde{\chi}^1 A''$ (3,56) 2,231 102,9 (4)
 $\tilde{\chi}^1 A''$ (1,49) 2,208 116,0 (4)

SiHF

1985

Kobayashi Hisayoshi,
Koga Toshikatsu.

Theor. chim. acta, 1985,
67, N1, 1-10.

(see. SiH₂; III)

HSiF

OM 31115

1985

102: 228788y Doppler-limited dye laser excitation spectroscopy of the $A^1A''(000)-X^1A'(000)$ band of fluorosilylene (HSiF). Suzuki, Tetsuo; Hakuta, Kohzo; Saito, Shuji; Hirota, Eizi (Inst. Mol. Sci., Okazaki, Japan 444). *J. Chem. Phys.* 1985, 82(8), 3580-3 (Eng). The $A^1A''(000)-X^1A'(000)$ band of HSiF was obsd. by Doppler-limited dye laser excitation spectroscopy. The HSiF mol. was produced by the reaction of SiH₃F with microwave discharge products of CF₄. The obsd. spectrum was almost free of perturbations and was readily assigned to ~1300 transitions of $K'a-K''a = 5-6, 4-5, 3-4, 2-3, 1-2, 0-1, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 0-0, 1-1,$ and $2-0$. A least-squares anal. of the obsd. spectrum yielded the rotational consts. and the centrifugal distortion consts. for both the A and X states. The mol. structure was discussed using the obsd. rotational consts.

($A^1A'' - X^1A'$)
bp 110°C

C.A. 1985, 102, N 26

1988a

HSiF

DM 31115

1985

22 Б1254. Спектроскопия возбуждения лазером на красителе полосы $\tilde{A}^1A''(000)$ — $\tilde{X}^1A'(000)$ HSiF с разрешением ограниченным допплеровским уширением. Doppler-limited dye laser excitation spectroscopy of the $\tilde{A}^1A''(000)$ — $\tilde{X}^1A'(000)$ band of HSiF. Suzuki Tetsuo, Hakuta Kohzo, Saito Shuji, Hirota Eizi. «J. Chem. Phys.», 1985, 82, № 8, 3580—3583 (англ.). Место хранения ГПНТБ СССР

С высоким разрешением ($\sim 1,3$ ГГц) измерен спектр возбуждения полосы $\tilde{A}^1A''(000)$ — $\tilde{X}^1A'(000)$ молекул HSiF образующихся при взаимодействии $^{29}\text{SiH}_4$ или SiH_3F с продуктами МВ-разряда через CF_4 . Спектры возбуждались перестраиваемым (415—445 нм) лазером на красителе непрерывного действия. Идентифицировано около 1300 переходов. Возмущений во вращат. структуре практически не наблюдалось. Получены след. зна-

(дл.н.)

X.1986, 19, № 22

чения вращат. молек. постоянных A , B , C , Δ_J , Δ_{JK} , Δ_K , δ_J , δ_K (в МГц) состояние $\tilde{A}^1A''(000)$ — 2793,67; 16457,6; 15471,5; 0,0240; 1,090; 116,2; 0,00166; 1,12; $\Phi_J = -4,4 \cdot 10^{-7}$, $\Phi_{J-K} = 1,3 \cdot 10^{-5}$, $\Phi_{KJ} = -5,9 \cdot 10^{-4}$, $\Phi_K = 0,157$; состояние $\tilde{X}^1A'(000)$ — 227217,9; 16915,93; 15698,7; 0,02562; 0,6737; 14,40; 0,00171; 0,415, $v_0 = 23260,0223 \text{ см}^{-1}$. Геометрич. параметры молекулы $R(\text{Si}-\text{H})$, $R(\text{Si}-\text{F})$ (А), $\Delta H \text{SiF}$ (град): состояние $\tilde{A}^1A''(000)$ — 1,484; 1,609; 111; состояние $\tilde{X}^1A'(000)$ — 1; 53; 1,605; 97. В. М. Ковба

HgF (Om. 26204) 1986

Suzuki T., Hirota E.,

($\tilde{A}'A'' - \tilde{B}A'$) J. Chem. Phys., 1986,
M.N. 85, N10, 5541-5546.

(Cer. HCF; iii)

HFSi

1986

104: 95919j A theoretical study of disfluorosilylborane. Bock, Charles W.; Trachtman, Mendel; Mains, Gilbert J. (Dep. Chem., Philadelphia Coll. Text. Sci., Philadelphia, PA 19144 USA). *J. Phys. Chem.* 1986, 90(1), 51-3 (Eng). The interactions were studied of singlet HFSi with BFH_2 and singlet F_2Si with BH_3 to produce F_2HSiBH_2 by using ab initio calcns. F_2Si forms an adduct with BH_3 which leads to a transition state for the 1,2 H shift. The equil. geometries were calcd. for the adduct, the transition state, and the "stable" F_2HSiBH_2 at HF/3-21G and HF/6-31G*(5D) levels. The interaction of HFSi with BFH_2 (a 1,2 fluorine shift to form disfluorosilylborane) of leads directly to disfluorosilylborane without the formation of an adduct and transition state. The deviation from planarity for the bonds emanating from the B atom are attributed to valence shell electron pair attraction.

meop · pac
rem



C.A.1986, 104, 412

H_3SiF

1987

3 Л221. ИК-спектр H_3SiF вблизи 2200 cm^{-1} , полученный методом фурье-спектроскопии высокого разрешения: колебательно-вращательный анализ основных полос ν_1 и ν_4 и находящихся с ними во взаимодействии полос $3\nu_6^{\pm 1}$ и $3\nu_6^{\pm 3}$. The high-resolution Fourier transform infrared spectrum of H_3SiF near 2200 cm^{-1} : Rovibrational analysis of the fundamentals ν_1 and ν_4 and their perturbers $3\nu_6^{\pm 1}$ and $3\nu_6^{\pm 3}$. В йгер Hans, Schulz Petra. «J. Mol. Spectrosc.», 1987, 125, № 1, 140—153

С помощью фурье-спектрометра изучена структура колебательно-вращательных полос ν_1 и ν_4 , наблюдаемых в ИК-спектре поглощения H_3SiF . С разрешением $\sim 0,006\text{ cm}^{-1}$ определены положения 2066 линий вращательной структуры полос. Колебательно-вращательный анализ наблюдаемых структур выполнен с учетом взаимодействия Кориолиса между ν_1 (A_1 и $\nu_4(E)$) с постоянной взаимодействия Кориолиса $\zeta_{1,4}\nu \approx 0,01\text{ cm}^{-1}$,

М.Н.

ф. 1988, 18, № 3

колебательных резонансов типа Ферми между v_1 (A_1), $v_4(E)$ и ангармонически расщепленными компонентами $3v_6^{\pm 3}(A_1)$, $3v_6^{\pm 1}(E)$, соответственно, с постоянными взаимодействия $F_{1666} \approx 0,61 \text{ см}^{-1}$ и $F_{4666} \approx 1,48 \text{ см}^{-1}$, а также с учетом ряда локальных возмущений, наблюдаемых в колебательно-вращательных структурах. В результате анализа определены молекулярные постоянные H_3SiF для основного и возбужденных колебательных состояний.

В. К.

FHSi

[om. 30490]

1988

(HSiF)

Jacob et. al.,

T_i,

J. Phys. and Chem. Ref.

D_i;

Data, 1988, 1², N², 299.

SiHF

L30353/

1988

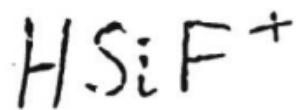
Краснов Р. С.,
Федорченко Н. В.,

С.Р.

(однор)

ОНИИ ТЭХИМ.

Ден. N 378 - ХП - 86,
Черкассы, 1988.



1989

Hopkinson A.C., dien M.H.

ab initio
paarct
crysxypot

Can. J. Chem. - 1989. - 67(6). -
931-7

● ($\text{C}_{\text{cr.}} \text{SiH}^+$, III)

1990

SiHF

Shin S.K., Goddard W.H.
et al.,

M.N.

J. Chem. Phys. 1990. 93,
N.F. C. 4986-4993.

(Cir.  CH₂; III)

SiHF

1993

Spoliti M., Ramondo F.,
et al.

neopent.

fraction

CNPGYM, THEOCHEM 1993, 102,

Pi, CMA-

Elliott.

73-83

(Al₄·SiF₂, II)

HSiF

1995

123: 125953c Chemical reaction jet spectroscopy, molecular structure, and the bending potential of the A'A'' state of monofluorosilylene (HSiF). Harper, Warren W.; Karolczak, J.; Clouthier, Dennis J.; Ross, Stephen C. (Dep. Chemistry, Univ. Kentucky, Lexington, KY 40506-0055 USA). *J. Chem. Phys.* 1995, 103(3), 883-91 (Eng). The jet-cooled laser induced fluorescence excitation spectrum of the A'A''-X'A' band system of HSiF was obsd. with the chem. reaction jet technique. Vibrational anal. of the spectrum gave upper state fundamental vibrational frequencies of $\nu_1 = 1547 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_2 = 558 \text{ cm}^{-1}$, and $\nu_3 = 857 \text{ cm}^{-1}$. Seven bands in the spectrum were recorded at high resoln. and rotationally analyzed, providing excited state mol. consts. The upper state vibrational and rotational bending levels were fitted to a semirigid bender model to obtain the equil. geometry and the potential energy barrier to linearity. Due to correlations in the parameters, it was necessary to fix the bond angle at the ab initio value of 114.5°. The resulting fitted model yielded $r_e(\text{Si}-\text{F}) = 1.602 \text{ \AA}$, $r_e(\text{Si}-\text{H}) = 1.548 \text{ \AA}$ with a potential energy barrier to linearity of 9130 cm^{-1} .

laserbott
CNRMP,

M.N.

C.A. 1995, 123, N10

HSiF
DSiF

1997

(M.N.)

126: 322655v Pulsed discharge jet spectroscopy of DSiF and the equilibrium molecular structure of monofluorosilylene. Harper, Warren W.; Hostutler, David A.; Clouthier, Dennis J. (Dep.of Chemistry, University of Kentucky, Lexington, KY 40506-0055 USA). *J. Chem. Phys.* 1997, 106(11), 4367-4375 (Eng), American Institute of Physics. The jet-cooled laser-induced fluorescence excitation spectrum of the $\bar{A}^1A''-\bar{X}^1A'$ band system of DSiF was obsd. using the pulsed discharge jet technique. Vibrational anal. of the spectrum yielded upper state harmonic vibrational frequencies of $\omega_1 = 1322$, $\omega_2 = 444$, and $\omega_3 = 867$ cm^{-1} . Vibronic bands involving all of the upper state fundamentals of HSiF and DSiF have now been rotationally analyzed, allowing a detn. of the excited state equil. structure as $r_e(\text{SiH}) = 1.526 \pm 0.014 \text{ \AA}$, $r_e(\text{SiF}) = 1.597 \pm 0.003 \text{ \AA}$, and $\theta_e(\text{HSiF}) = 115.0 \pm 0.6^\circ$. The harmonic frequencies and centrifugal distortion consts. were used to obtain harmonic force fields and av. (r_z) structures for the ground and excited states. The ground state av. structure was used to est. the equil. structure of $r_e(\text{SiH}) = 1.528 \pm 0.005 \text{ \AA}$, $r_e(\text{SiF}) = 1.603 \pm 0.003 \text{ \AA}$, and $\theta_e(\text{HSiF}) = 96.9 \pm 0.5^\circ$.

C.A. 1997, 126, N24

2001

| 135: 202107g Single vibronic level emission spectroscopy of jet-cooled HSiF and DSiF. Hostutler, David A.; Clouthier, Dennis J.; Judge, R. H. (Department of Chemistry, University of Kentucky, Lexington, KY 40506-0055 USA). *J. Chem. Phys.* 2001, 114(24), 10728-10732 (Eng), American Institute of Physics. Using the technique of single vibronic level emission spectroscopy, the ground state vibrational manifolds of jet-cooled HSiF and DSiF have been studied. The radicals were produced in a pulsed elec. discharge jet using trifluorosilane (HSiF_3 or DSiF_3) as the precursor. The gas phase ground state harmonic vibrational frequencies of both isotopomers have been detd. for the first time. A normal coordinate anal. using the vibrational frequencies and literature values for the centrifugal distortion consts. allowed the detn. of all six ground state force consts. Our previous ground state rotational consts. have been combined with the calcd. harmonic contributions to the α consts. to obtain an av. (r_z) structure and an est. of the equil. (r_{eq}) structure. The reliability of the force consts. has been evaluated by Franck-Condon simulations of the emission spectra and comparisons of the calcd. and exptl. detd. inertial defects.

HSiF
DSiF

CRAKMP,
FRANCISAN-
NOCM, 2e,
CCL-NOCM

C.A. 2001, 135, N9